

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成16年10月28日(2004.10.28)

【公開番号】特開2002-207443(P2002-207443A)

【公開日】平成14年7月26日(2002.7.26)

【出願番号】特願2001-364243(P2001-364243)

【国際特許分類第7版】

G 0 9 F 9/30

H 0 5 B 33/14

H 0 5 B 33/22

【F I】

G 0 9 F 9/30 3 6 5 Z

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/22 B

H 0 5 B 33/22 D

【手続補正書】

【提出日】平成15年10月16日(2003.10.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0050】

電界発光層62は、例えば、燐光を利用する低分子有機電界発光物質を使用しており、真空蒸着法により形成される。陽極層58と電界発光層62との間に正孔注入層33及び正孔輸送層34を介在させ、電界発光層62と陰極層63との間には正孔遮断層36及び電子輸送層37を介在させている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0063

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0063】

電界発光層82は、例えば、燐光を利用する低分子有機電界発光物質を使用しており、真空蒸着法により形成される。陽極層78と電界発光層82との間に正孔注入層33及び正孔輸送層34を介在させ、電界発光層82と陰極層83との間には正孔遮断層36及び電子輸送層37を介在させている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0073】

電界発光層102は、例えば、燐光を利用する低分子有機電界発光物質を使用しており、真空蒸着法により形成される。陽極層98と電界発光層102との間に正孔注入層33及び正孔輸送層34を介在させ、電界発光層102と陰極層103との間には正孔遮断層36及び電子輸送層37を介在させている。

【手続補正4】

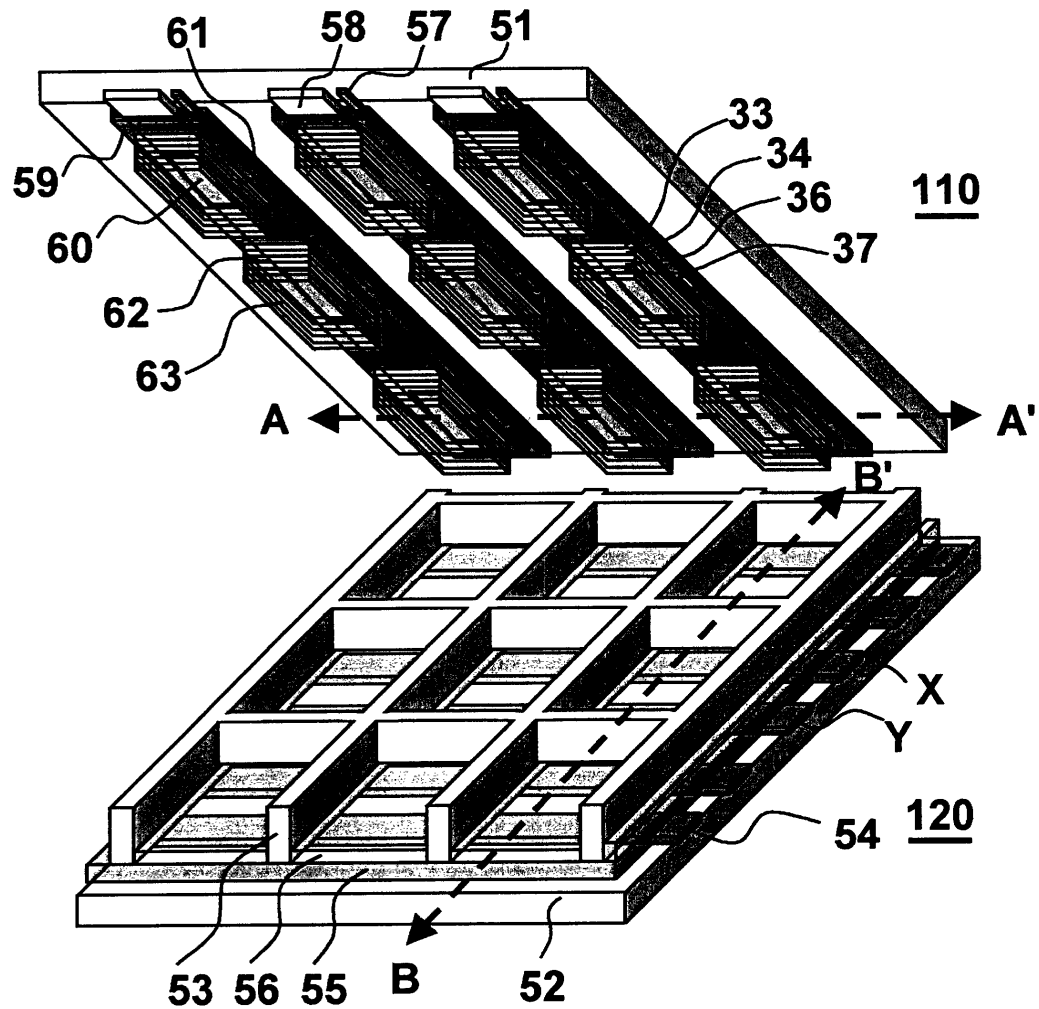
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 1】



【手続補正 5】

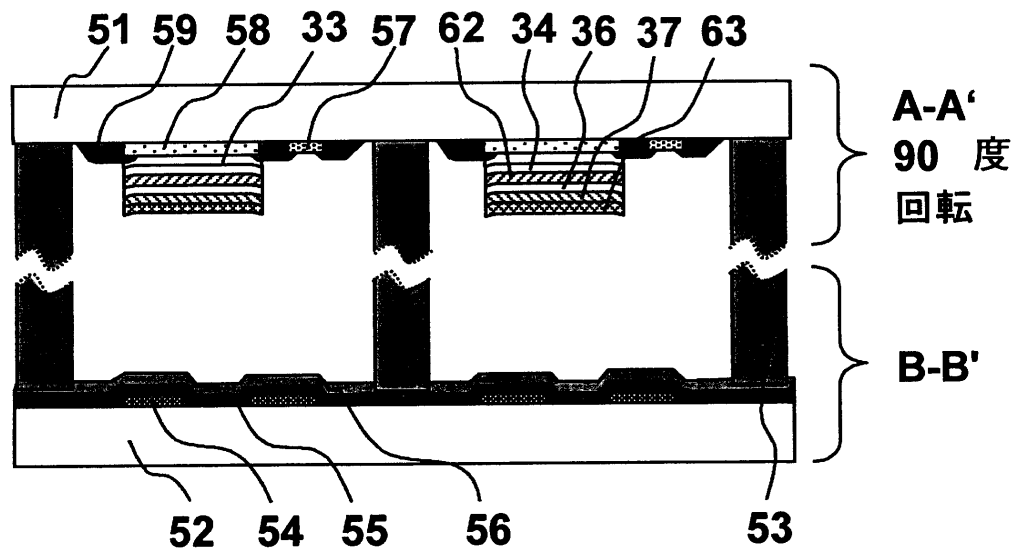
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 図 2 】



【 手続補正 6 】

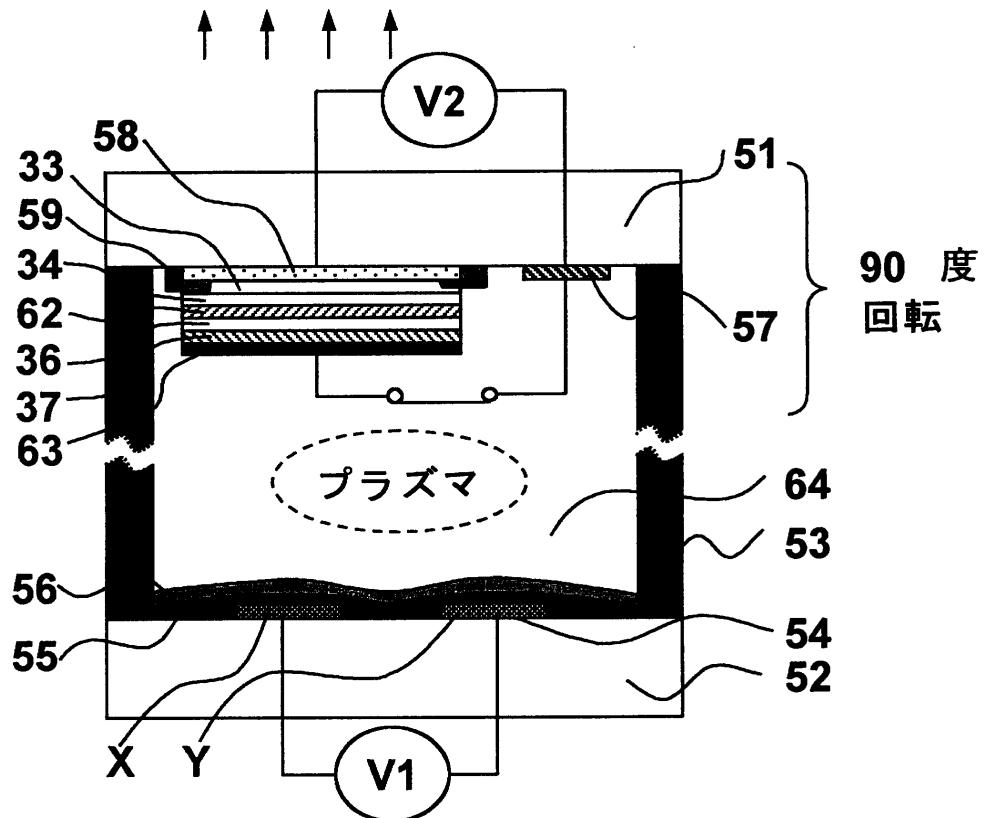
【 補正対象書類名 】 図面

【 補正対象項目名 】 図 3

【 補正方法 】 変更

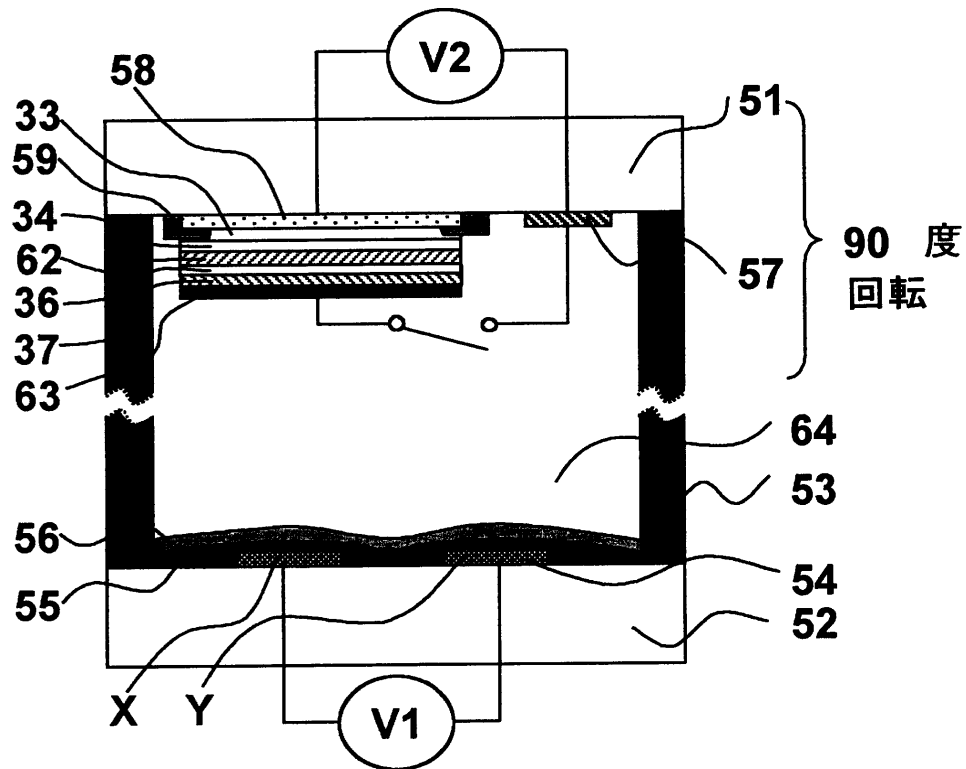
【 補正の内容 】

【 図 3 】



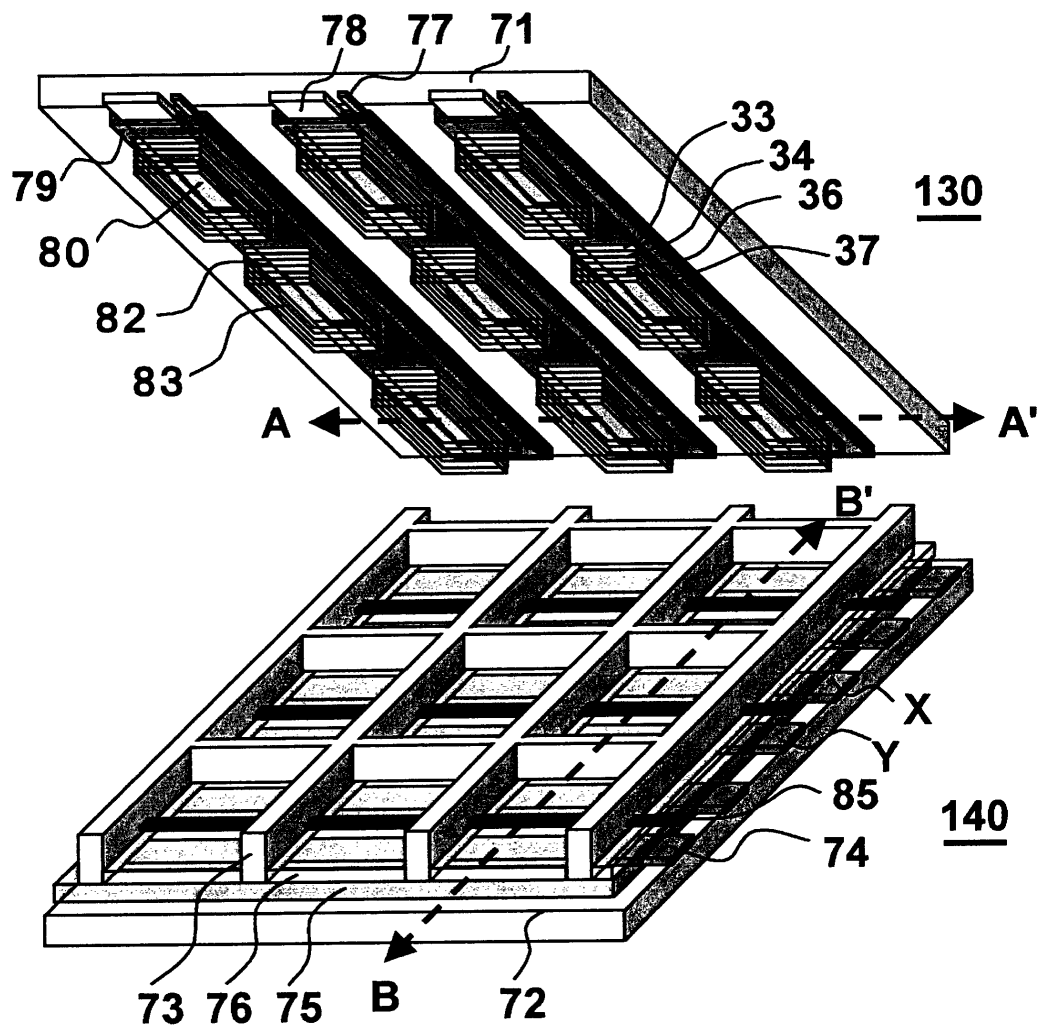
【 手続補正 7 】

【補正対象書類名】図面  
【補正対象項目名】図 4  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【図 4】



【手続補正 8】  
【補正対象書類名】図面  
【補正対象項目名】図 5  
【補正方法】変更  
【補正の内容】

【 図 5 】



【 手続補正 9 】

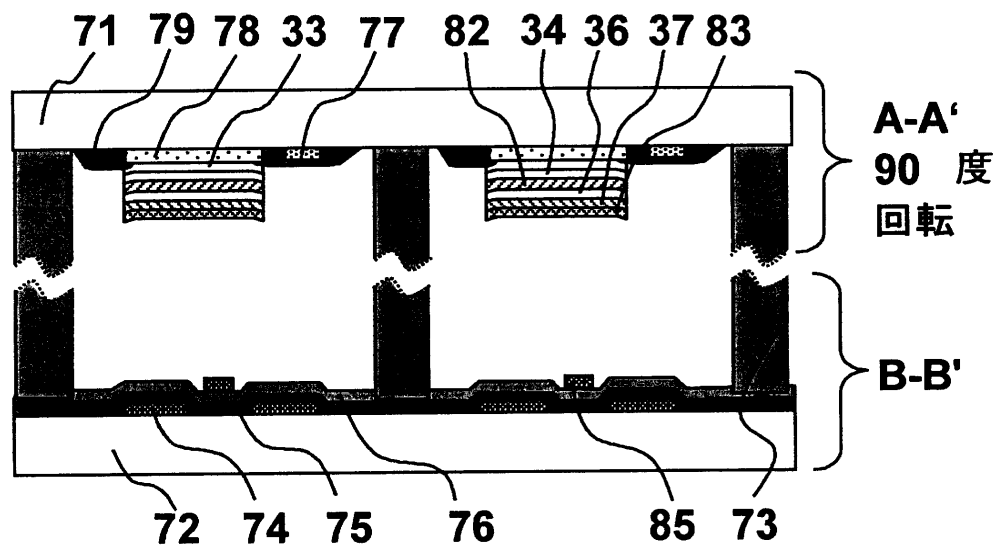
【 補正対象書類名 】 図面

【 補正対象項目名 】 図 6

【 補正方法 】 変更

【 補正の内容 】

【 図 6 】



【 手続補正 1 0 】

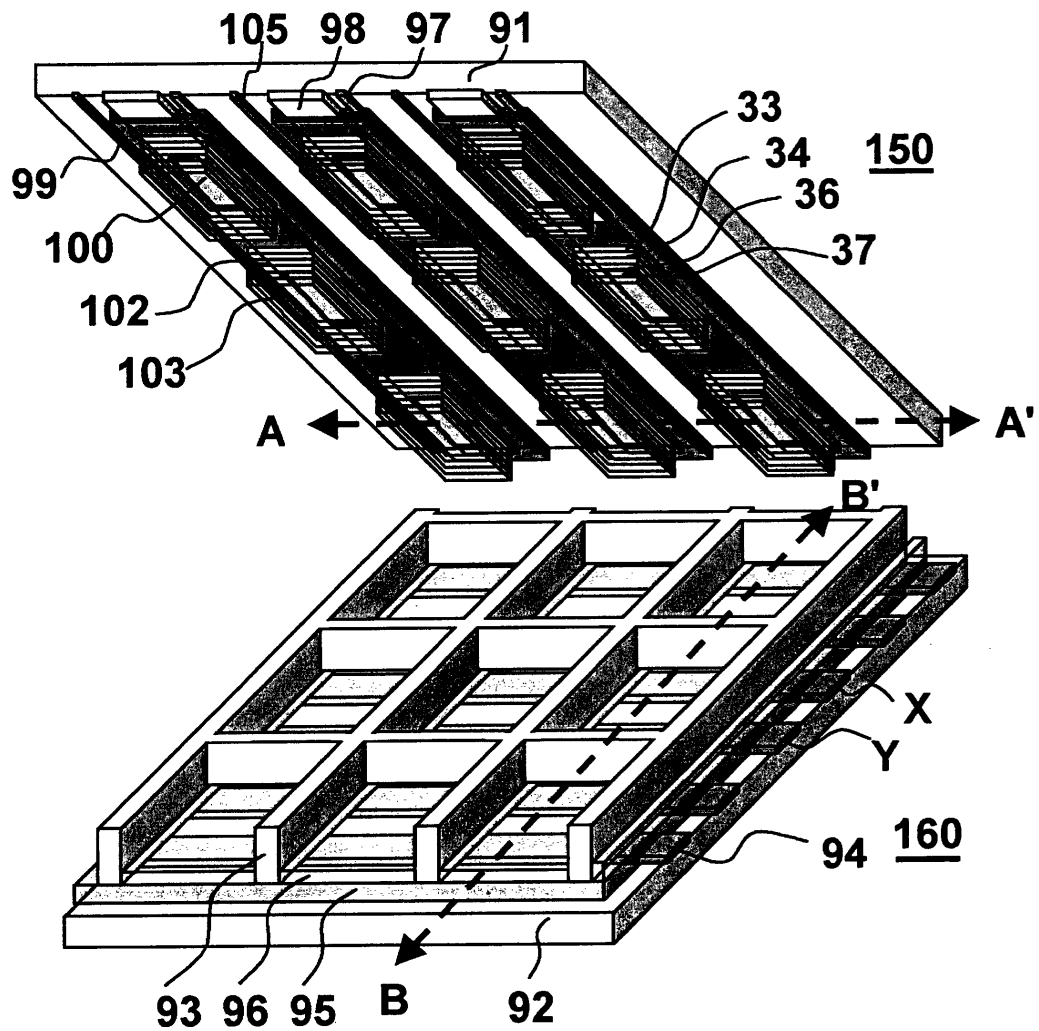
【 補正対象書類名 】 図面

【 補正対象項目名 】 図 7

【 補正方法 】 変更

【 補正の内容 】

【 図 7 】



【 手続補正 1 1 】

【 補正対象書類名 】 図面

【 補正対象項目名 】 図 8

【 補正方法 】 変更

【 補正の内容 】

【 図 8 】

